

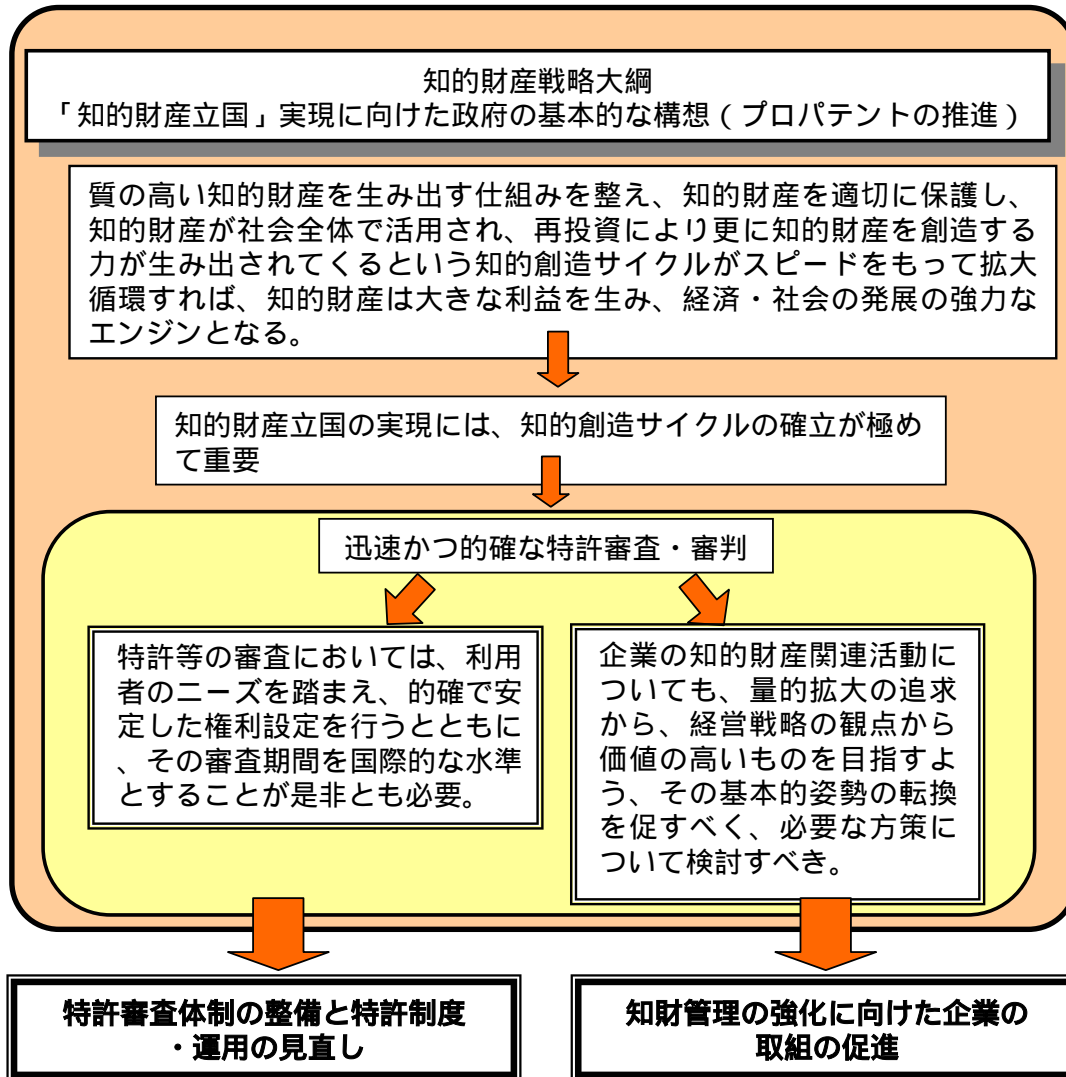
産業構造審議会知的財産政策部会
特許制度小委員会

最適な特許審査に向けた特許制度の在り方について
中間取りまとめ 概要版

< 目次 >

- ・ 特許制度見直しの基本的視点
- ・ 特許審査をめぐる状況
- ・ 特許審査体制の整備と特許制度・運用の見直し
- ・ 知財管理の強化に向けた企業の取組の促進

・特許制度見直しの基本的視点（１）



・特許制度見直しの基本的視点（２）

・特許審査体制の整備と
特許制度・運用の見直し



1．特許審査体制の強化

2．先端技術分野等における
創造的な技術革新の促進

3．ユーザーニーズに対応した
早期の権利付与

4．国際的な権利取得の円滑化

・知財管理の強化に向けた
企業の取組の促進



1．企業等における戦略的な
知的財産の取得・管理

2．出願・審査請求構造改革
への取組

・特許制度見直しの基本的視点（３）

知的財産基本法における規定

（権利の付与の迅速化等）

第１４条 国は、発明、植物の新品種、意匠、商標その他の国の登録により権利が発生する知的財産について、早期に権利を確定することにより事業者が事業活動の円滑な実施を図ることができるよう、所要の迅速かつ的確な実施を可能とする審査体制の整備その他必要な施策を講ずるものとする。

２ 前項の施策を講ずるに当たり、その実効的な遂行を確保する観点から、事業者の理解と協力を得るよう努めるものとする。

（国際的な制度の構築等）

第１７条 国は、知的財産に関する国際機関その他の国際的な枠組みへの協力を通じて、各国政府と共同して国際的に整合のとれた知的財産に係る制度の構築に努めるとともに、知的財産の保護に関する制度の整備が十分に行われていない国又は地域において、本邦法人等が迅速かつ確実に知的財産権の取得又は行使をすることができる環境が整備されるよう必要な施策を講ずるものとする。

（新分野における知的財産の保護等）

第１８条 国は、生命科学その他技術革新の進展が著しい分野における研究開発の有用な成果を知的財産権として迅速かつ適正に保護することにより、活発な起業化等を通じて新たな事業の創出が期待されることにかんがみ、適正に保護すべき権利の範囲に関する検討の結果を踏まえつつ、法制上の措置その他必要な措置を講ずるものとする。

２ 国はインターネットの普及その他社会経済情勢の変化に伴う知的財産の利用方法の多様化に的確に対応した知的財産権の適正な保護が図られるよう、権利の内容の見直し、事業者の技術的保護手段の開発及び利用に対する支援その他必要な施策を講ずるものとする。

・特許審査をめぐる状況（１）

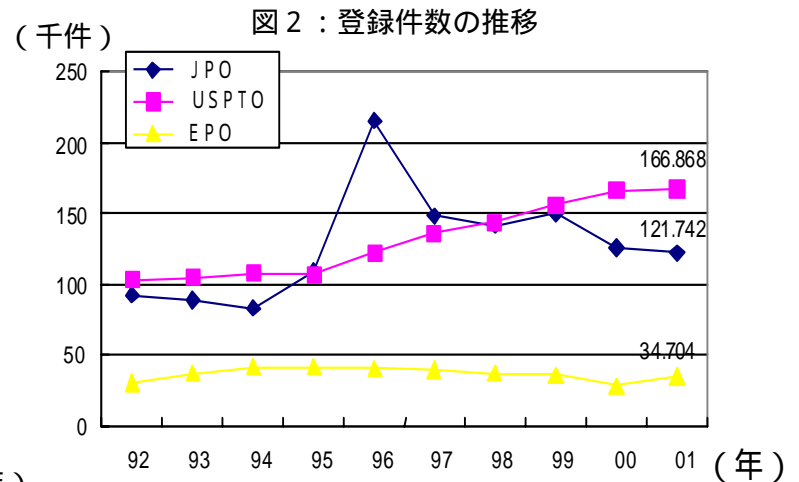
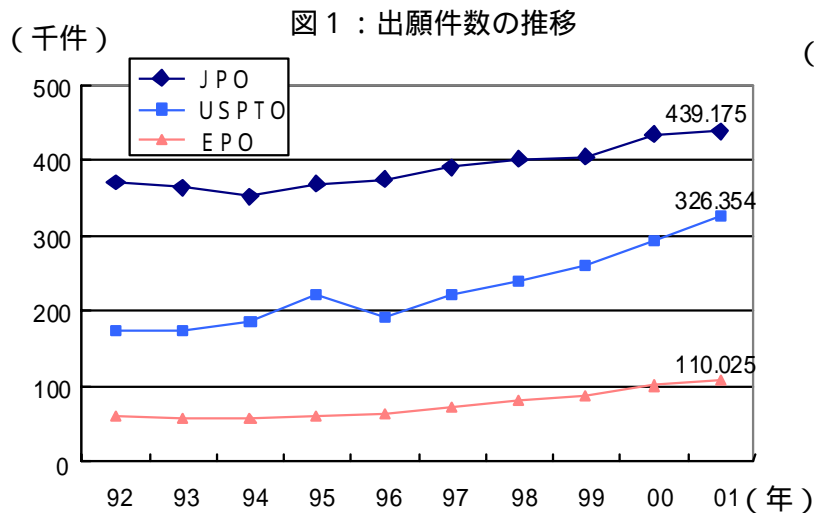
プロパテント時代における主要国の動向

世界各国における特許出願は先進国を中心に急増している。

日本 43万9千件(2001年:過去5年の年平均伸び率3.2%増)

米国 32万6千件(同11.3%)

欧州特許庁 11万件(同11.5%増)



注 : J P O の 1 9 9 6 年 は 付 与 後 異 議 制 度 導 入 の た め 一 時的に特許査定が重複的に発生

出典 : 特許庁年報、USPTO年報、EPO年報

・特許審査をめぐる状況（２）

技術革新及びグローバル化が特許出願に与える影響

(1) 創造的技術革新を支える大学発の特許創出

大学やTLO等からの特許出願は、我が国において未だ米国に比べ低調であるが、今後、大学発の特許の創出が強く期待されるなど、より一層の特許出願の増加を予想。

図４：日本における大学、承認TLOの出願件数の推移

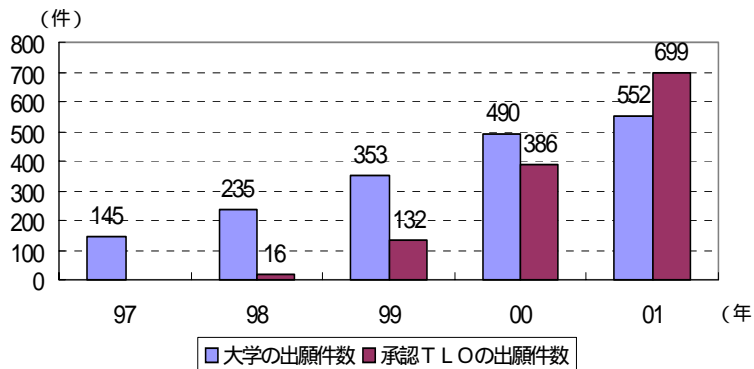
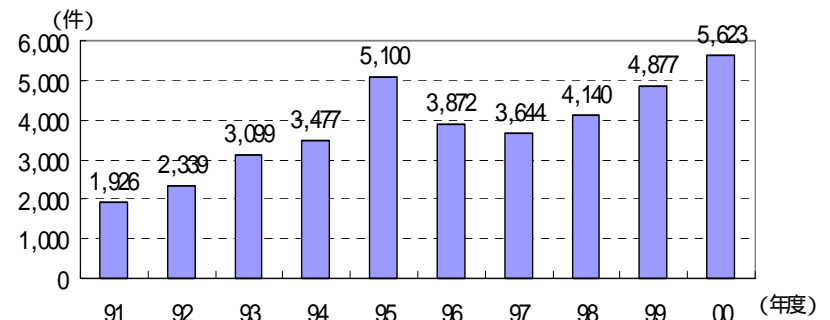


図５：米国の大学における特許出願件数の推移



・特許審査をめぐる状況（3）

技術革新及びグローバル化が特許出願に与える影響

(2) グローバル化を背景とした国際的な特許出願の増加

欧米先進国では海外での特許取得を重視する傾向にある。

我が国は欧米先進国に比べて依然国内重視の傾向だが、今後は国際出願の増加が予想される。

特許協力条約(PCT)に基づく国際特許出願(PCT出願)は指数関数的に増加している。

図6：国内及び国外における特許取得件数推移

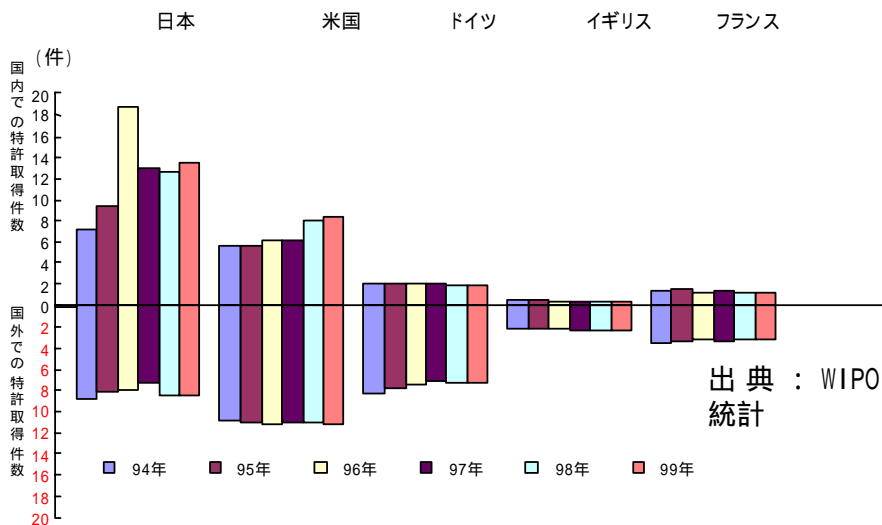
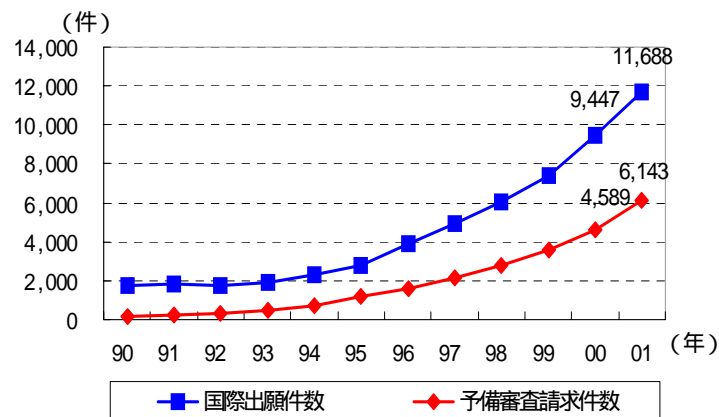


図7：我が国における国際出願及び国際予備審査請求の推移



・特許審査をめぐる状況（４）

審査請求件数の推移

近年、特許出願件数の伸びを上回るペースで審査請求件数が増加している。

今後、審査請求期間の短縮による一時的な審査請求件数の急増や、最終審査請求率の上昇が生じることが予想されており、審査請求件数は、最大で現状の倍近くにまで増加するとも予想される。

図 9：出願件数の推移

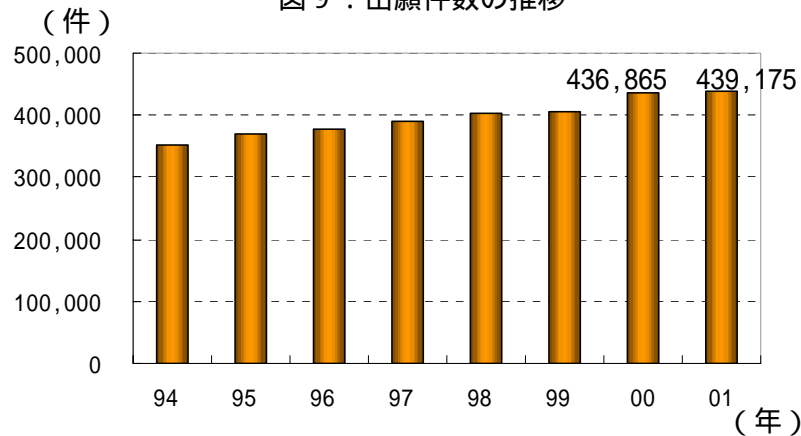
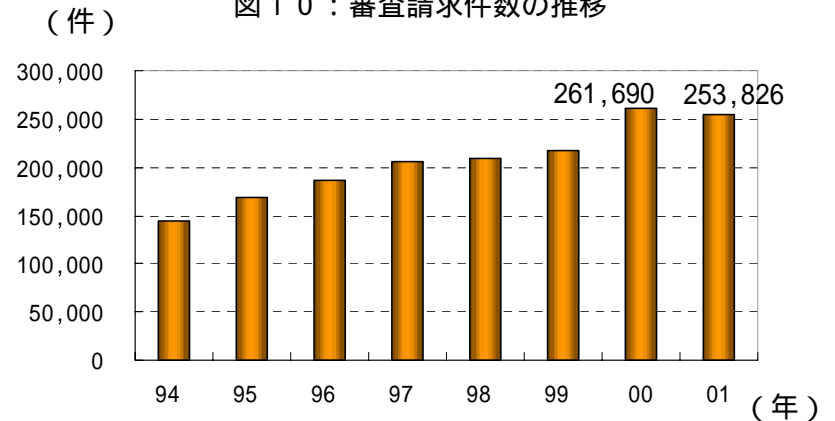


図 10：審査請求件数の推移



・特許審査をめぐる状況（５）

審査負担の状況

特許出願1件当たりの請求項数が一貫して増加するなど、特許審査負担は年々増大している。我が国特許庁の審査官は、一人当たり欧米の審査官の2～3倍にのぼる審査を行っている。

図12：一出願に含まれる発明の数
（平均請求項数）の推移

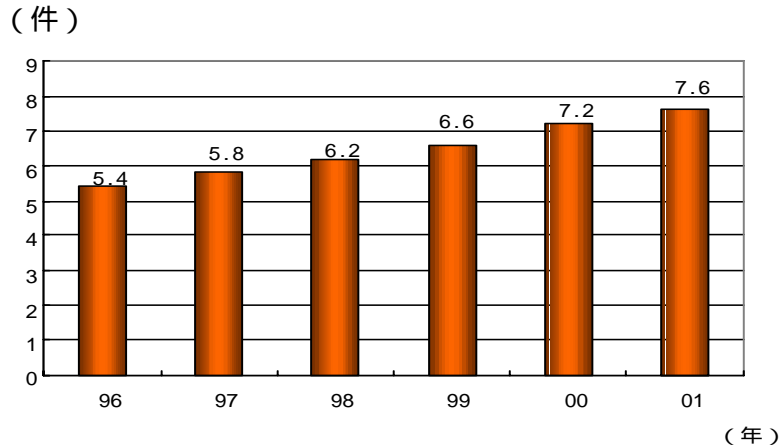
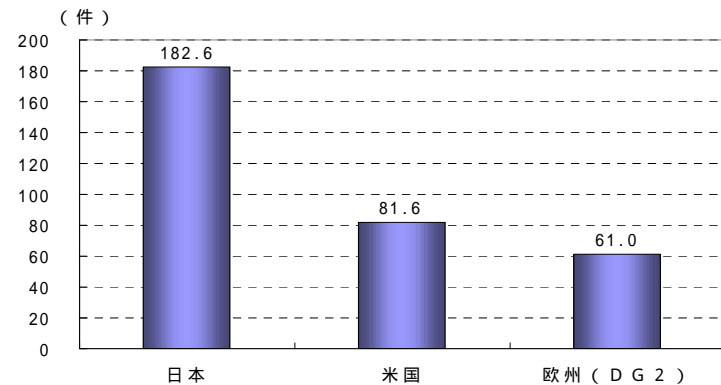


図13：2001年の一人当たりの最終審査+
国際予備審査件数比較（米国のみ2001年度）



出典：特許庁年報、USPTO
年報、EPO年報

・特許審査をめぐる状況（６）

審査待ち期間の将来見通し

審査請求から、特許庁の最初の応答が行われるまでの期間（審査待ち期間）は約22か月であり、そのほとんどの期間は実際の審査に着手するまでの「待ち期間」であるため、特許審査の迅速化のためには、審査待ちの状態にある特許出願を減少させることが重要。

ここ2年間は、審査請求件数が審査着手件数を大幅に上回る状況で滞貨は増加中であり、審査請求件数と審査着手件数の不均衡を解消し、審査待ち期間の長期化の懸念に対応すべき。

また、審査待ち期間の長期化に対する懸念は、主要先進国共通の課題。

表1：三極審査待ち件数、審査待ち期間、最終審査期間

	審査待ち件数（件）		審査待ち期間（月）		最終審査期間（月）	
	2000年	2001年	2000年	2001年	2000年	2001年
日本	433,020	478,363	21.1	22.0	26.9	27.7
米国	485,129	542,007	13.0	14.4	24.7	24.7
欧州	191,600	212,200	20.7	20.7	50.1	46.1

出典：2001年三極

・特許審査体制の整備と特許制度・運用の見直し（１）

特許審査体制の強化

迅速かつ的確な特許審査の実現のため、特許審査官の増員や能力の一層の向上、先行技術調査等に関するアウトソーシングの拡充、審査補助職員の活用による総合的な取組により、審査体制の強化に努める。

図 1 4：三極における審査官数の推移

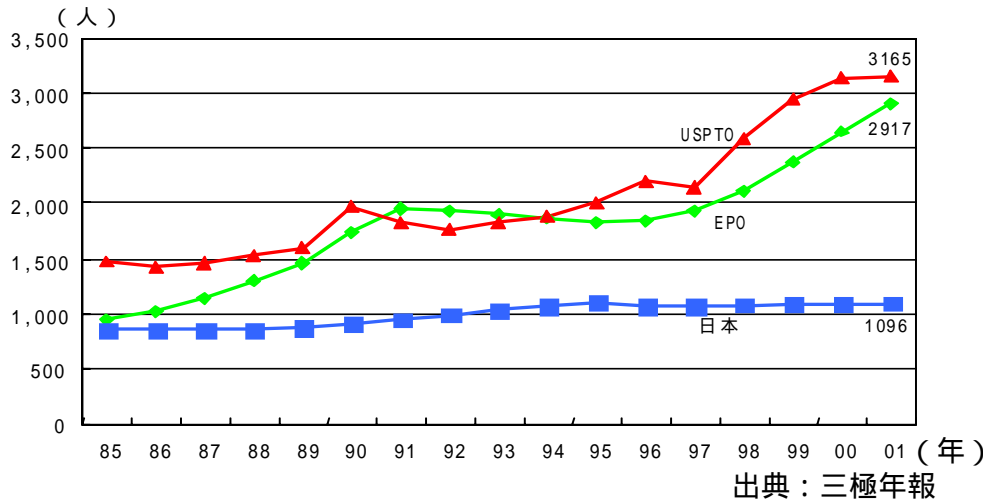


表 2：アウトソーシングの予算推移

年度	1998	1999	2000	2001	2002
外注予算 (分類付与 + 検索外注)	69.4億円	83.9億円	110.4億円	142.2億円	162.9億円
分類付与外注件数	5.2万件	16.3万件	49.6万件	44.2万件	44.1万件
検索外注件数	12.0万件	12.0万件	12.0万件	14.0万件	14.6万件
(内、対話型検索外注)				2.0万件	6.0万件

図 1 5：納品型検索外注及び対話型検索外注及び納品型検索外注のイメージ

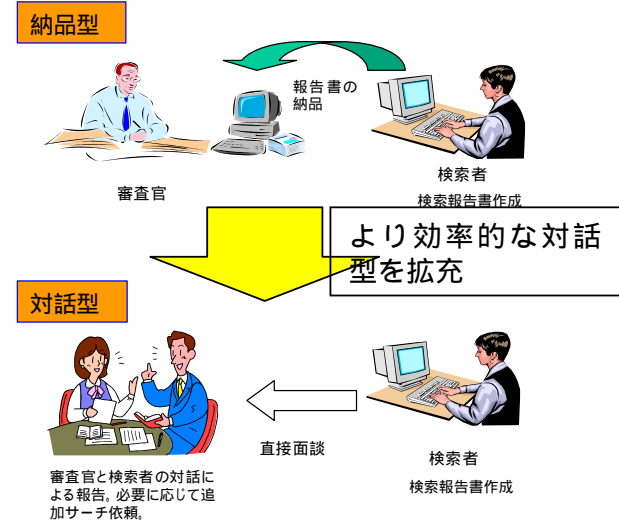


表 3：審査補助職員の活用状況

	2002年度	2003年度
予備的見解書作成担当 (審査官OB等)	42人	55人
国際・新支庁担当 (博士課程在籍・修了者等)	4人	15人

2002年度は実績、2003年度は予算上の人数

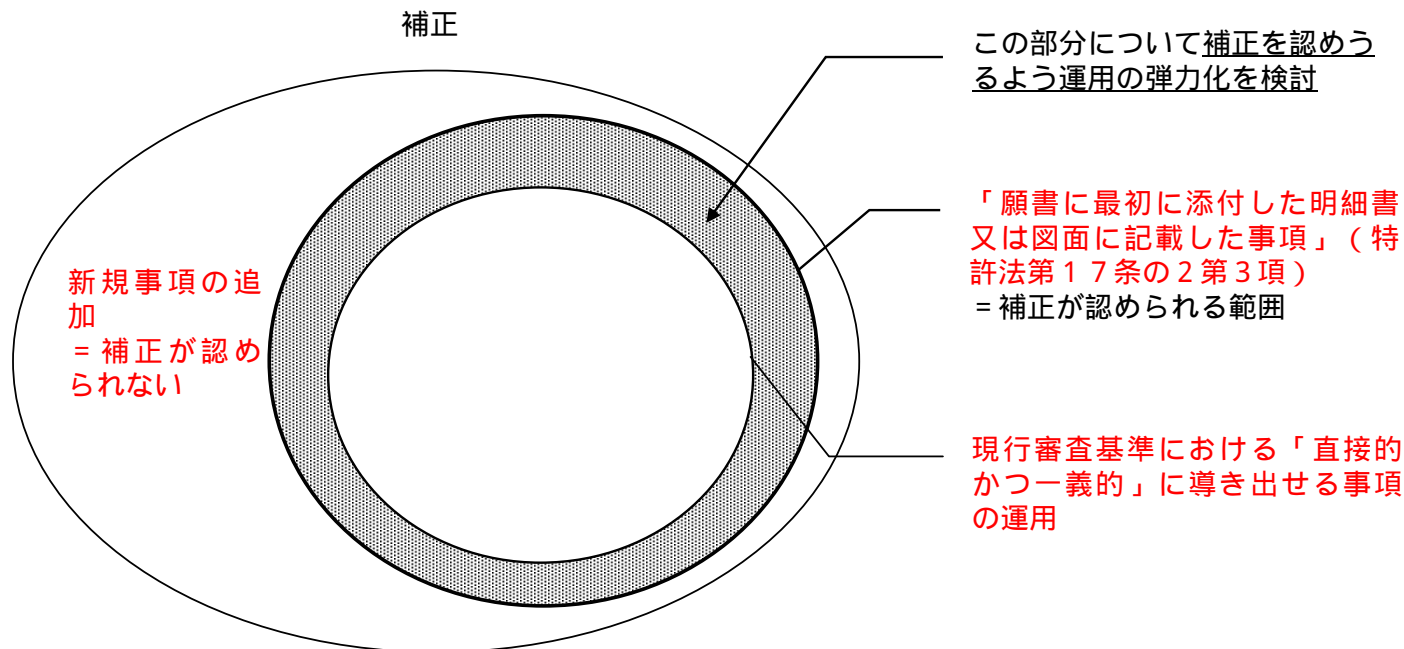
・特許審査体制の整備と特許制度・運用の見直し（２）

先端技術分野等における創造的な技術革新の促進

技術革新の進展、国際的な競争の激化のなかで、特に先端技術分野（先端医療分野等）における研究開発成果を時機を逸せず適切に保護するための対応の強化により、知的財産創造のインセンティブの強化を図る。

また、基幹的な発明等についての適切な権利確保を可能とするとの観点から、補正制度の運用の弾力化を図る。

図 1 6：補正制度見直しの概念図

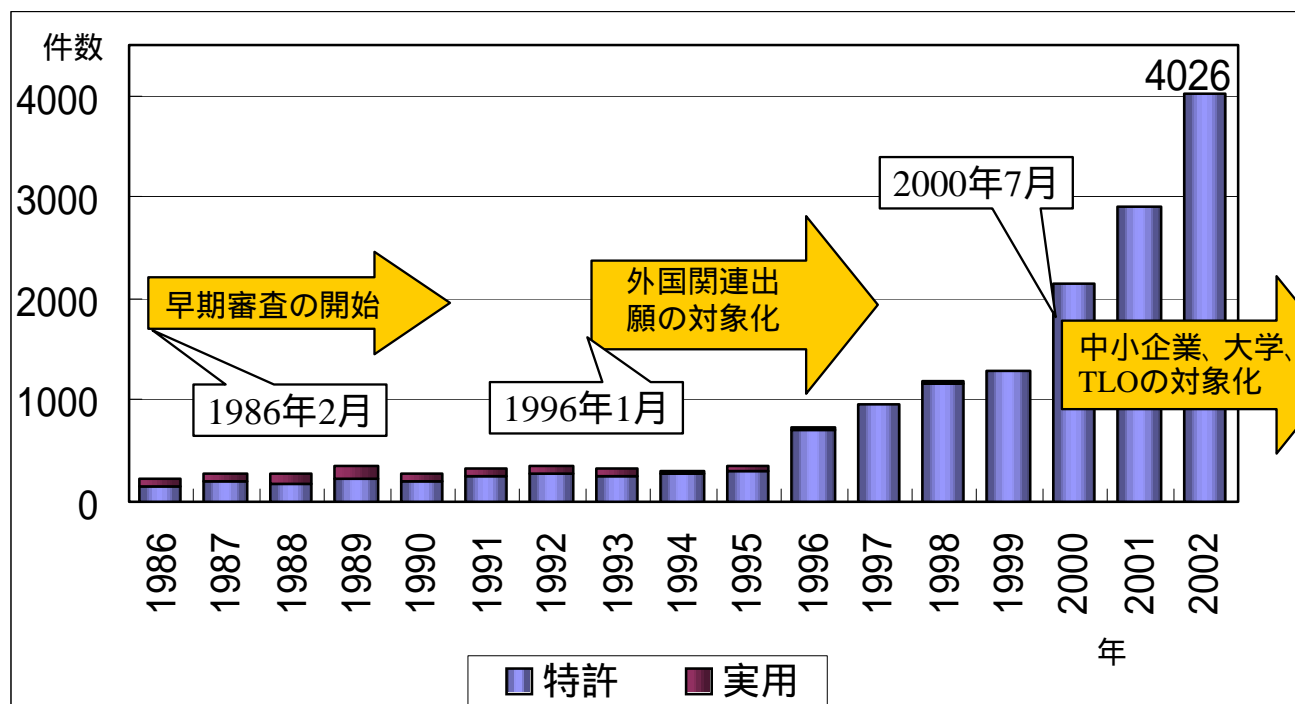


・特許審査体制の整備と特許制度・運用の見直し（3）

ユーザーニーズに対応した早期の権利付与

発明の事業化を早急に行う出願、大学等や中小ベンチャー企業の出願等、早期の権利付与が必要と判断される出願について優先的に審査を行う早期審査制度について、更なる活用を促進。(2002年実績4,026件(暫定値))

図17：早期審査の申し出件数推移



2002年は暫定値

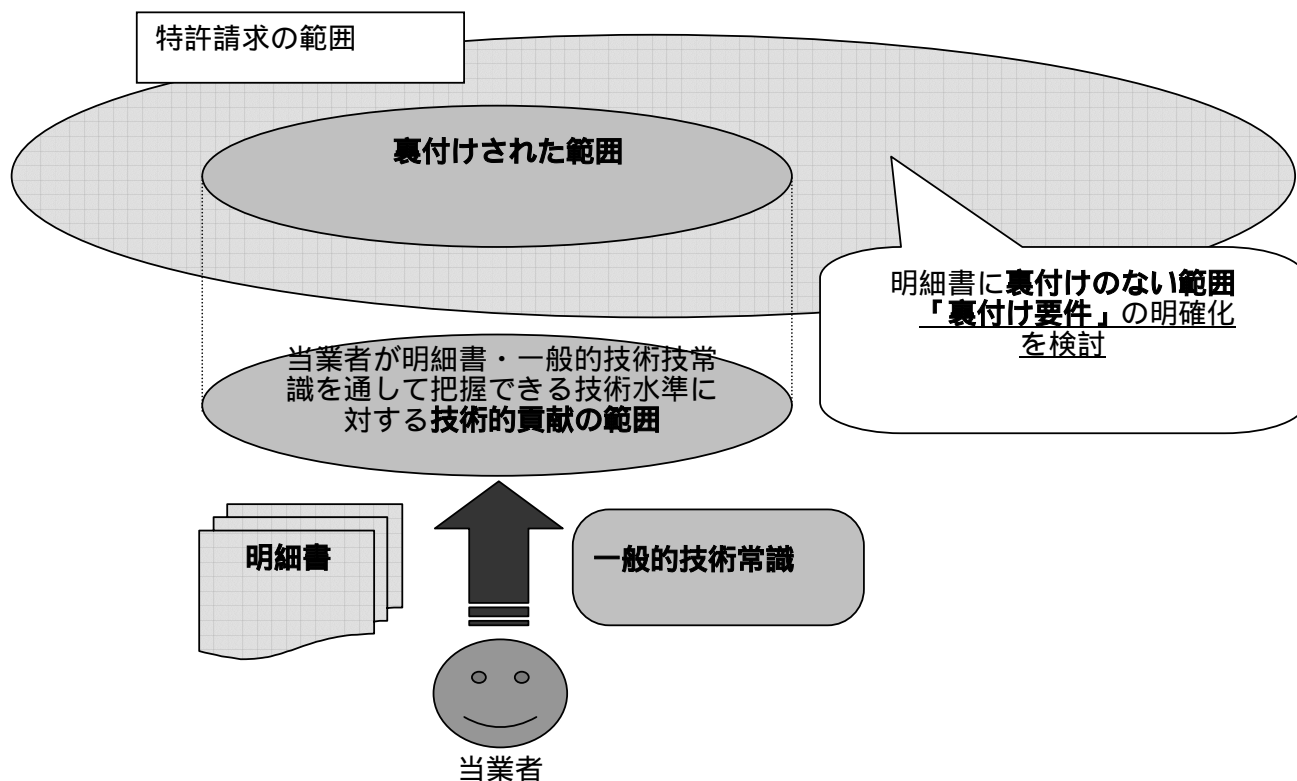
出典：特許庁内データ

・特許審査体制の整備と特許制度・運用の見直し（４）

国際的な権利取得の円滑化

我が国産業の国際競争力強化の観点から、国際的な権利取得の円滑化に向け、日米特許庁間のサーチ結果協力プロジェクトなどの特許審査協力をはじめ特許審査制度・運用の国際的調和や国際的な審査協力を更に推進。

（１）裏付け要件の明確化

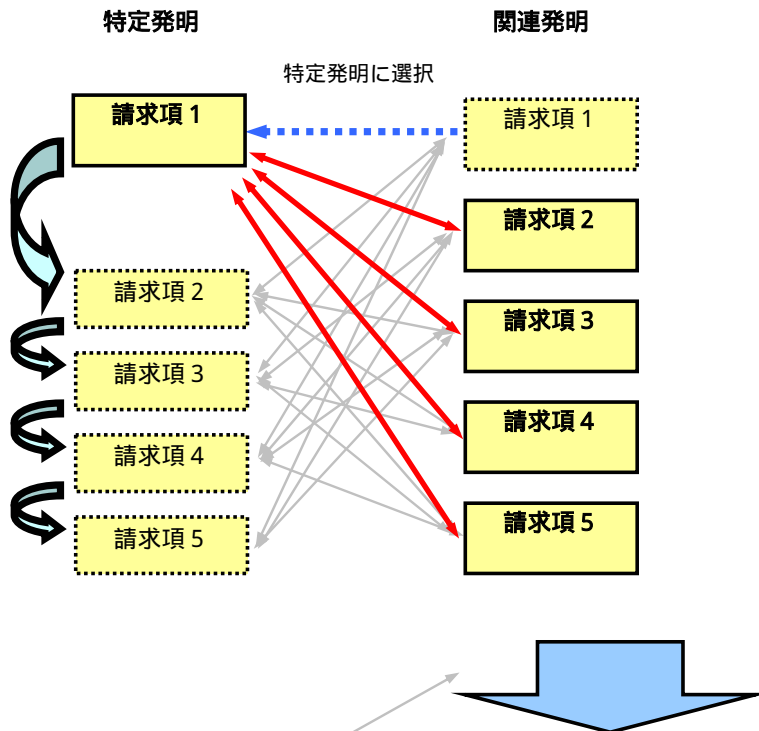


・特許審査体制の整備と特許制度・運用の見直し（５）

（２）単一性判断基準の見直し

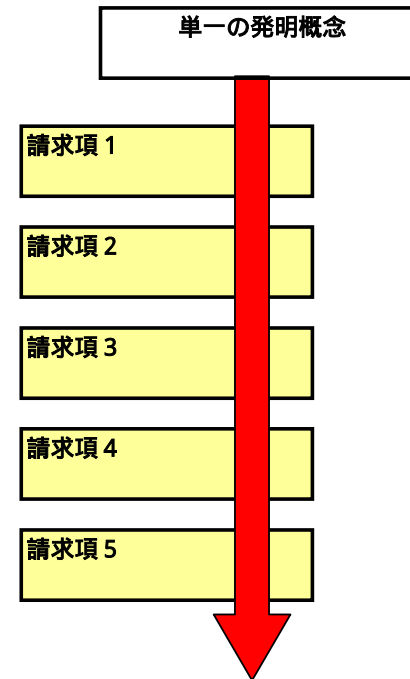
我が国の単一性判断手法

全ての請求項を順番に特定発明として、他の請求項（関連発明）との間に、特許法第37条第1号～5号に規定された関係があるかを判断
これと他の請求項（関連発明）との関係が、発明の利用分野及び課題が同一である等の5つのタイプのいずれかを満たすか否かを判断



PCTの単一性判断手法

全ての請求項を貫く単一の発明概念があるかを判断



PCT等の規定を参考に単一性要件の見直しを検討

． 知財管理の強化に向けた企業の取組の促進（１）

企業における戦略的な知的財産の取得・管理

我が国企業について急務であるグローバルな競争を意識した戦略的な対応を確保するため、経営戦略の観点から知的財産を重視した企業行動を促すとともに、知的財産の取得・管理のための戦略的なプログラム策定に資する「参考となるべき指針」とその普及など、そのための環境整備に努める。

知的財産の取得・管理指針（案）の目次

- ．取得・管理指針の背景
- 1．知的財産と企業経営
- 2．本指針と知的財産戦略大綱
- ．企業における取組みの意義と必要性
- 1．「選択と集中」の要請
- 2．事業戦略や研究開発戦略としての知的財産戦略
- 3．本指針の対象企業と適用
- 4．対象となる知的財産の範囲
- ．各社が参考とすべき対策
- 1．基本理念・戦略の策定
- 2．知的財産権をベースにした事業戦略及び研究開発戦略の策定
- 3．社内取得・管理体制の構築
- 4．効果的な取得・管理の実施
- 5．フォローアップ及びレビューの徹底
- 6．組織の最高責任者による見直し

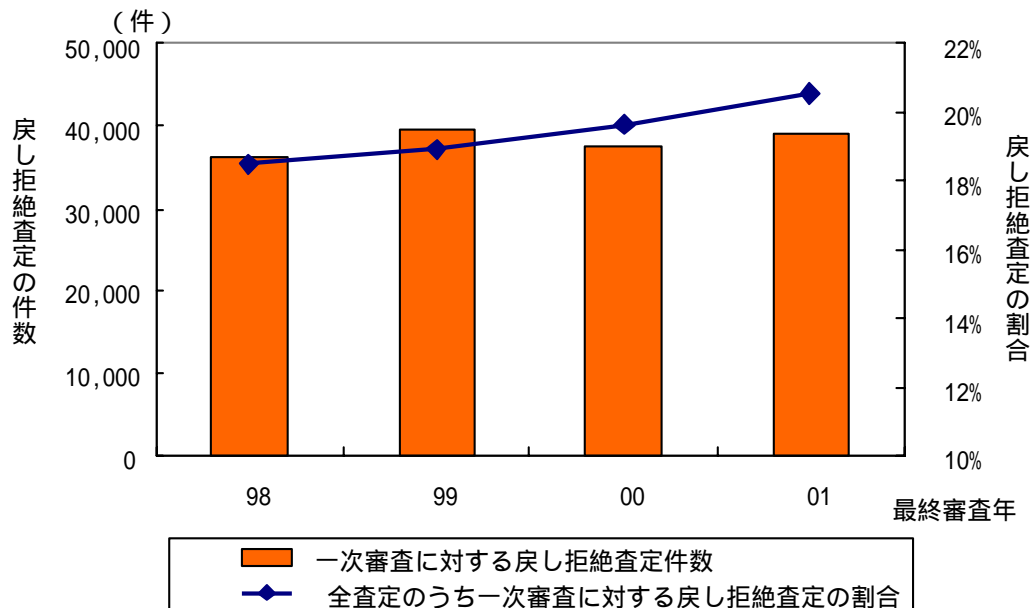
・ 知財管理の強化に向けた企業の取組の促進（２）

出願・審査請求構造改革への取組

我が国の産業競争力の強化に資する企業、大学等からの出願に対し、国際的にみて遜色のない迅速かつ的確な権利付与を実現するため、特許制度を我が国全体として最適な形で効率的に運用するための出願・審査請求構造の改革を官民の協力のもと総合的な対応により推進すべき。

なお、「戻し拒絶」の一部に見られるような特許性の乏しい出願の審査請求が特許庁の審査負担を増大させている一因であることを認識する必要あり。

図 20：一次審査に対する戻し拒絶査定件数及び全査定に占める割合



・ 知財管理の強化に向けた企業の取組の促進（３）

出願・審査請求構造改革への取組

(1) 特許関係料金体系の見直し

特許関係料金の基本的考え方

・ 出願料（特許出願を行う時に支払う料金）

発明の奨励の観点から、容易に出願できる程度の額に設定される。

・ 審査請求料（審査を請求する時に支払う料金）

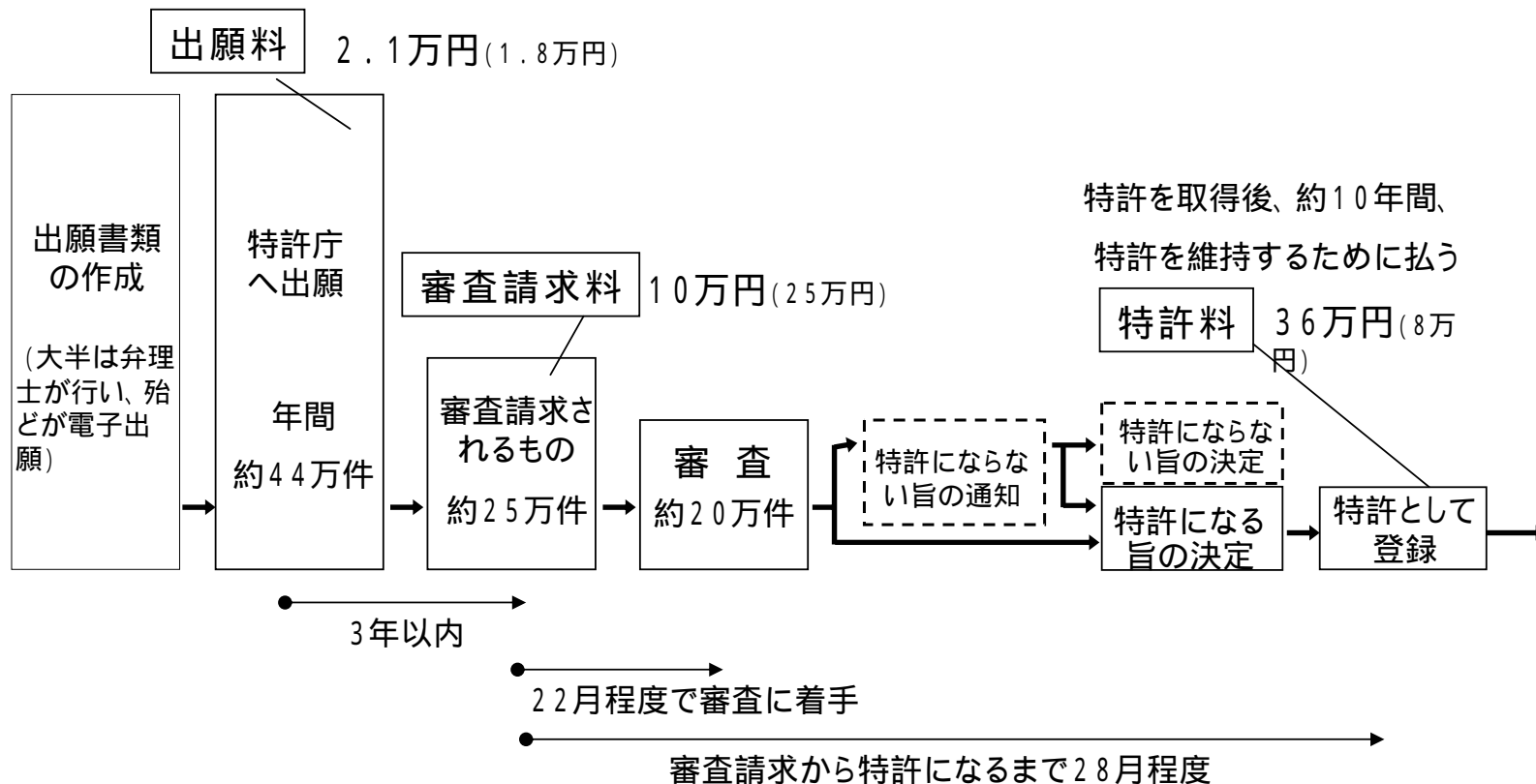
審査請求制度は、特許出願のうち、特許性や事業性に乏しいものについて出願人が審査請求の可否について精査することにより、全体の特許審査を促進するという趣旨で創設されたものであることから、審査請求料は、出願人に適正な審査請求行動を期待し得る程度の水準に設定される。

・ 特許料（特許権を維持している間に支払う料金）

特許特別会計は、受益者による費用負担により総経費をまかなうことを原則としていることから、特許料は、出願料及び審査請求料と合わせた場合に、特許制度全体の円滑な運用を維持するための総費用がまかなわれるように設定される。

・ 知財管理の強化に向けた企業の取組の促進（４）

(参考) 特許手続きと、出願料・審査請求料・特許料



(注1) 金額は特許1件当たりの平均的ケース〔()内は実際にかかる費用を試算〕

(注2) 出願後3年以内に審査請求をしなければ、出願は取り下げになる

・ 知財管理の強化に向けた企業の取組の促進（５）

出願・審査請求構造改革への取組

(1) 特許関係料金体系の見直し

現行料金体系の問題点

ア) 費用負担の不均衡の拡大

現在、審査費用の増大と、企業毎の特許率のばらつきが大きくなる傾向にあるが、現行料金体系の下では、特許料によって審査に要する費用等の不足分を補う体系となっており、特許率の高い出願人と低い出願人との間の費用負担の不均衡が拡大しつつある。

イ) 審査請求料による審査請求行動の適正化作用の低下

近年、審査請求件数が増大し、審査待ち期間は長期化の傾向をみせている。また、一次審査における拒絶理由に対して、出願人が何らの応答も無く拒絶査定となる率（戻し拒絶査定率）は、審査の全査定件数の20%前後にまで上昇。これらの傾向の要因の一つは、適正な審査請求行動を促すための審査請求料が十分に機能する額に定められていないことにあると考えられる。

・知財管理の強化に向けた企業の取組の促進（6）

出願・審査請求構造改革への取組

(1) 特許料金体系の見直し

コスト負担の不均衡を是正し、適正な審査請求を実現するため、特許性の高い出願を多く審査請求し特許取得する出願人ほど、出願から特許取得、権利維持のトータルの負担が現行料金体系に比べて軽減される、有利な料金体系とするよう特許料金体系の見直し(出願料、特許料の引下げ、審査請求料の引上げ)を行い、企業の戦略的な取組に対するインセンティブの強化を図る。

表4：朝日監査法人による実費試算結果

	現行料金	14年度実費	今後10年実費
出願料	21,000円	17,708円	16,433円
審査請求料	96,700円	252,958円	303,066円
設定登録料 / 1件(毎年)	18,208円	8,715円	9,609円
特許料 / 1件(毎年)	42,309円	8,715円	9,623円

注1：現行料金の出願料は現行規定どおりの額。審査請求料は、基本額と、請求項の数に比例する変動額との合計額として規定されているため、請求項数を6.2(平成13年度実績値)とて計算。また、設定登録料は、13年度の設定登録料の納付実績÷特許登録件数により、また、特許料は、特許料の納付実績÷設定登録から4年目以降の現存特許権件数により計算。

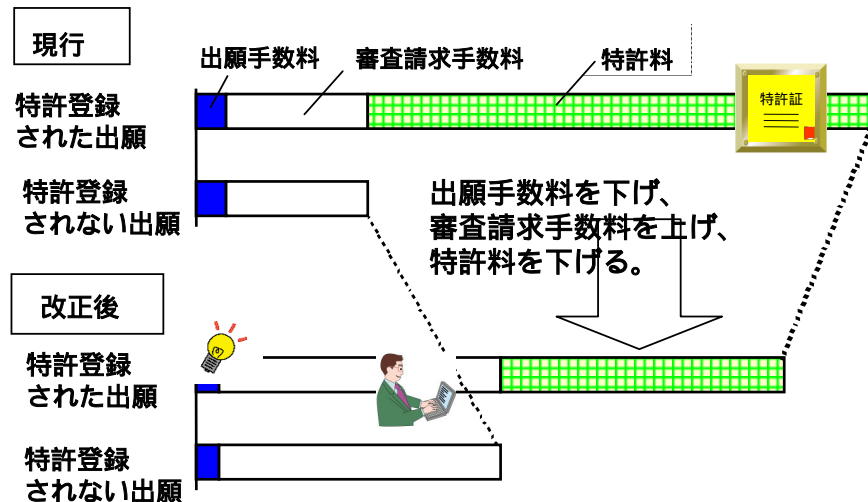
注2：今後10年実費は、平成15年度 - 24年度までの歳出及び処理件数予測より試算。

< 特許料金体系の見直しの方向性 >

	出願料	審査請求料
現在の提案	1.6万円程度	20万円前後 ～25万円前後

なお、特許料は、審査請求料の水準に合わせて18万円程度～10万円程度で収支相償となるよう検討。

< 特許料金体系見直しの概念図 >



・ 知財管理の強化に向けた企業の取組の促進（ 7 ）

出願・審査請求構造改革への取組 - 新たな料金体系への円滑な移行

- ・ 今回の料金改定は、出願人の中の費用負担の不均衡の是正の観点から、出願料から特許料までトータルの料金体系を見直したものであることから、改定後の料金体系は施行日以降の出願に適用。
- ・ 新たな料金体系を特許法改正後の出願から適用することとした場合には、審査請求料の引上げの影響が特許料の引下げに先行して生じることとなり、一時的に出願人の負担が増加。
- ・ このため、新たな料金体系への円滑な移行を図る観点から、料金体系の見直しに伴う効果を減殺することのない範囲内で、負担軽減措置を講ずることを検討。具体的には、特許特別会計の収支見通し等を勘案しつつ、以下の措置を検討。

中小・ベンチャー企業、大学等に対する支援措置の拡充(後述)
料金改定時に導入する審査請求料の返還制度を前倒して適用
現行料金が適用される特許権に対して何らかの引下げ措置を実施

・ 知財管理の強化に向けた企業の取組の促進（ 8 ）

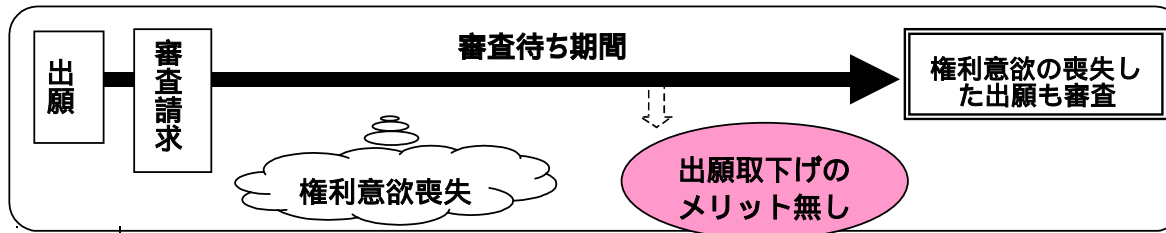
出願・審査請求構造改革への取組

(2) 審査請求後に取り下げられた出願に対する審査請求料の一部返還

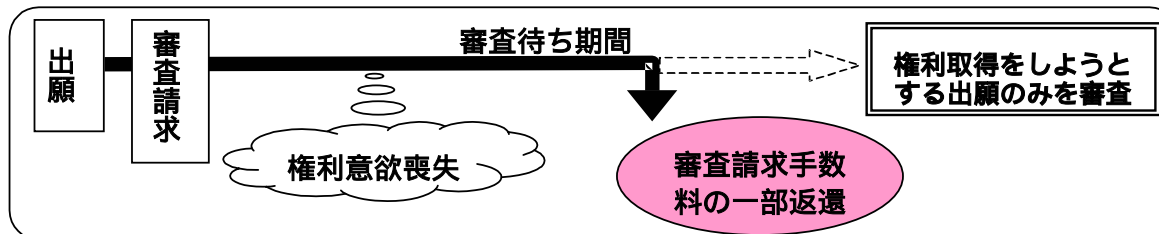
審査開始前に出願の取下げがあった場合に、請求により審査請求手数料の一部を返還する制度を導入することにより、権利取得の必要性がない出願に係る出願人の負担を軽減し、その取下げを促進する。

< 審査請求手数料返還制度の導入概念図 >

現行 審査待ちの期間に出願を取り下げても、既納の審査請求手数料は返還されない。



改正後 審査待ちの期間に出願を取り下げた場合、請求により審査請求手数料の返還制度の導入。



・知財管理の強化に向けた企業の取組の促進（９）

出願・審査請求構造改革への取組

(3) 中小・ベンチャー企業や大学等に対する特許取得等に関する支援措置の拡充

現在、中小・ベンチャー企業に対する審査請求料等の減免措置としては、特許法で「資力に乏しい個人及び法人に対する減免措置」が講じられているとともに、産業技術力強化法において「研究開発型中小企業に対する料金の減額措置」がなされている。

しかし、減額制度自体が十分に知られていないことや制度利用の手続の煩雑さ、現在の制度対象では不十分である等のために、これらの減額規定の利用実績は必ずしも多くない。

このため、中小企業関係団体等とも連携しつつ、制度の普及や利用の円滑化等制度の利用拡大を図るとともに、対象の拡大について検討する必要がある。

大学における減免措置としては、産業技術力強化法により「大学や大学の研究者等に対する審査請求料等の軽減措置」が実施されている。

今後、国立大学の法人化、知財本部の整備等の動きも踏まえ、既存の独立行政法人に対する料金の在り方も勘案しつつ、特許関連料金の在り方について引き続き検討する必要あり。

・知財管理の強化に向けた企業の取組の促進（10）

現行の特許料等の減免措置

対象者	審査請求料	特許料（1年目～3年目）
国（国立大学、国研を含む）	免除	免除
独立行政法人	免除	免除
大学（公私立大学） 大学教員	半額	半額
承認TLO（大学発の国有以外の特許）	半額	半額
認定TLO（国立大学の特許）	免除	免除
認定TLO（国研・独立行政法人の特許）	免除	免除
技術力強化に資する者（研究開発型中小企業）	半額	半額
資力に乏しい法人	半額	猶予（3年間）
資力に乏しい個人	免除又は半額	免除又は猶予（3年間）